УДК 537.333

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАРЯДОВОЙ И ТОКОВОЙ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СИЛЬНОТОЧНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА ВО ВНЕШНЕМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ ПРИ ИНЖЕКЦИИ ВПЛАЗМУ

В.П. Григорьев, Е.С. Вагин, В.В. Офицеров

Томский политехнический университет E-mail: grig@am.tpu.ru

Рассмотрена задача моделирования процесса транспортировки электронного пучка в камере, заполненной плазмой низкого давления с учетом токовой и зарядовой нейтрализации пучка. Приведено описание численной модели, разработанной в среде MatLab. Приведены результаты моделирования.

Ключевые слова:

Физика плазмы, электронный пучок, уравнение Пуассона, метод макрочастиц, транспортировка пучка электронов, зарядовая нейтрализация, токовая нейтрализация.

Key words:

Plasma physics, electron beam, Poisson's equation, particle-in-cell simulation method, electron beam transportation, charge neutralization, current neutralization.

Низкоэнергетические сильноточные электронные пучки (с токами в десятки кА и энергиями электронов в десятки кэВ) привлекают внимание своей способностью, переносить запасенную энергию без существенных потерь на достаточно больрасстояния и эффективно шие передавать ее объекту воздействия [1-3]. Поэтому большой интерес представляет использование электронных пучков с такими параметрами в различных технологических процессах, связанных с изменением состояния и свойств поверхности материалов. При низких энергиях и высоких плотностях токов транспортировка сильноточных электронных пучков (СЭП) к мишени представляет значительные трудности из-за необходимости обеспечения практически полной зарядовой нейтрализации, а также достаточной высокой токовой нейтрализации.

Введение

Высокая степень зарядовой нейтрализации с одной стороны уменьшает поперечные силы пространственного заряда пучка, а с другой, позволяет избежать ограничение предельного тока, вызванного образованием виртуального катода, практически полностью запирающего пучок на входе в пространство дрейфа. Для этого транспортировку низкоэнергетических СЭП осуществляют, инжектируя их в плазму или нейтральный газ низкого давления (10⁻¹...10⁻² Па). Что касается токовой нейтрализации, то это необходимо для подавления самопинчевания электронного пучка в собственном магнитном поле. Чтобы обеспечить указанные условия транспортировка пучка происходит в присутствии внешнего продольного магнитного поля. Кроме того, внешнее магнитное поле позволяет удерживать пучок от рассыпания при низкой зарядовой нейтрализации в переходных режимах.

Формирование пучка с заданными параметрами, а также его транспортировка без существенных потерь, представляет сложную задачу. Создание оптимальных условий для переноса энергии пучка к мишени и осуществления управления его параметрами требует самосогласованного изучения вопросов нейтрализации заряда и тока электронного пучка при его транспортировке в плазме и внешнем магнитном поле.

В предыдущих работах авторов [4, 5] была представлена модель нейтрализации заряда пучка при его инжекции в плазму. В данной работе, кроме зарядовой нейтрализации, учитывается и токовая нейтрализация пучка, обусловленная ускорением электронов плазмы, индуцированное полем на фронте пучка. Представлены результаты исследования зарядовой и токовой нейтрализации при инжекции низкоэнергетических СЭП в предварительно созданную плазму во внешнем магнитном поле.

Основные уравнения физической модели

При транспортировке интенсивного пучка электронов происходит взаимодействие пучка с плазмой. Инжекция пучка приводит к образованию потенциала в области пучка, что заставляет электроны плазмы покидать область инжекции. При этом ионы плазмы из-за высокой относительной массы (обычно это однозарядные ионы аргона) остаются в области и обеспечивают зарядовую нейтрализацию транспортируемого пучка, в результате чего на основную часть импульса действует только фокусирующие силы со стороны собственного и внешнего магнитных полей. За счет нейтрализации пространственного заряда уменьшается провисание потенциала, появляется возможность избежать образования виртуального катода и запирание пучка. Это позволяет транспортировать самофокусированные пучки с токами выше, чем те, которые возможно достичь при транспортировке пучка в вакуумных каналах. Если при нарастании тока пучка индуцируемая им вихревая ЭДС достаточно высока, то это ведет к возбуждению тока в плазме, направленного противоположно току пучка на переднем фронте пучка. В зависимости от проводимости плазмы вихревое электрическое поле может приводить к эффективной токовой нейтрализации и, следовательно, к компенсации собственного магнитного поля в системе.

Математическая модель самосогласованной динамики пучка в поле пространственного заряда пучка и магнитных полях при его транспортировке в пространстве дрейфа (рис. 1), заполненного плазмой с однородной плотностью n_0 , разработана на основе описания электронов пучка и плазмы макрочастицами [6]. Здесь L и R – длина и радиус трубы дрейфа; R_b – радиус пучка; J_z – плотности тока в пространстве дрейфа; B_z^* – внешнее магнитное поле; V_z – скорость электронов пучка; r, z, θ – компоненты цилиндрической системы координат. Модель построена для области, совпадающей с областью камеры, и имеет размерность 2,5 (трехмерная по динамике, двумерная по полям).

При построении модели предполагалась аксиальная симметрия процессов $\partial/\partial \theta=0$, преобладание продольного тока пучка $J_z >> J_r$, J_{θ} и неподвижность ионов (концентрация ионов плазмы считается однородной и постоянной $n_i=n_0$).

Динамика электронов пучка и плазмы описывается системой релятивистских уравнений в цилиндрической системе координат:

$$\begin{cases} \frac{d(\gamma_{\alpha}\dot{z})}{dt} = -\frac{e}{m_0}(\dot{r}B_{\theta} + E_z) \\ \frac{d(\gamma_{\alpha}\dot{r})}{dt} = -\frac{e}{m_0}(r\dot{\theta}B_z^* - \dot{z}B_{\theta} + E_r) + \gamma_{\alpha}r\dot{\theta}^2, \\ \frac{1}{r}\frac{d(\gamma_{\alpha}r^2\dot{\theta})}{dt} = \frac{e}{m_0}(\dot{r}B_z^*) \end{cases}$$
(1)

где m_0 — масса покоя электрона; e — элементарный заряд; E_z , E_r , B_θ — компоненты собственного элек-

тромагнитного поля пучка; B_z^* =const – компонента внешнего магнитного поля; γ_{α} – релятивистский фактор частиц α ; α – электроны пучка и плазмы.

Собственное поле пучка описывается уравнениями Пуассона для скалярного потенциала Ф и продольной компоненты векторного потенциала *А*,:

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial\Phi}{\partial r}\right) + \frac{\partial^{2}\Phi}{\partial z^{2}} = -\frac{1}{\varepsilon_{0}}\rho,$$
(2)

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial A_z}{\partial r}\right) + \frac{\partial^2 A_z}{\partial z^2} = -\mu_0 J_z,$$
(3)

где ε_0 , μ_0 – диэлектрическая и магнитная постоянные; ρ , J_z – плотности заряда и тока в пространстве дрейфа, зависящие от уровня полей.

Плотности заряда и тока пучка в уравнениях (2), (3) связаны уравнением непрерывности:

$$\operatorname{div} \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0.$$
(4)

Суммарная плотность заряда в уравнении (2) описывается соотношением:

$$\rho = \rho_b + (\rho_i + \rho_e), \tag{5}$$

где ρ_b , ρ_e — плотности заряда электронов пучка и плазмы. Плотность ионов плазмы с большой степенью точности можно считать постоянной. Это связано с тем, что при достаточно высокой степени ионизации газа в области давлений $10^{-1}...10^{-2}$ Паионизация газа электронами пучка практически поддерживает плотность плазмы на постоянном уровне, компенсируя рекомбинацию, поэтому определим плотность заряда ионов плазмы как $\rho_i = n_0 e$.

Начальное условие для плотности заряда электронов пучка задано как $\rho_{b|_{r=0}}=0$, что соответствует отсутствию пучка в трубе дрейфа.

Плотность тока J_z рассчитывается как сумма плотностей тока электронов пучка j_{bz} и плазмы j_{pz} , определяемые соотношениями:



Рис. 1. Труба дрейфа частиц пучка

$$J_{z} = j_{bz} + j_{pz},$$
 (6)

$$j_{bz} = \rho_b \dot{z},\tag{7}$$

$$\frac{1}{\upsilon_{ef}}\frac{\partial j_{pz}}{\partial t} = -j_{pz} + \sigma E_z, \qquad (8)$$

где v_{ef} – эффективная частота упругих столкновений электронов плазмы с нейтральными атомами и ионами; σ – проводимость плазмы:

$$\sigma = \frac{n_e c^2}{m_e v_{ef}},$$

$$v_{ef} = v_{ei} + v_{ea},$$

$$v_{ei} = 0,286 \cdot 10^{-4} \frac{n_i}{T_e^{3/2}} \left(\frac{L}{10}\right),$$

$$L = 23, 4 - 1,15 \cdot \lg n_i + 3,45 \cdot \lg T_e,$$

$$v_{eg} = 4,08 \cdot 10^{-8} n_g T_e,$$

где υ_{ea} и υ_{ei} – частоты упругих столкновений электронов плазмы с нейтральными атомами и ионами; c – скорость света; n_a , n_i и n_e – концентрация нейтральных атомов, ионов и электронов плазмы; T_e – температура электронов.

Граничные условия для потенциалов задаются исходя из условий идеальной проводимости поверхности стенок трубы (r=R) и условия непрерывности потенциалов на оси трубы (r=0) и на торцах трубы (z=0 и z=L):

$$\frac{\partial A_z}{\partial r}\Big|_{r=0} = \frac{\partial \Phi}{\partial r}\Big|_{r=0} = 0, \ \Phi\Big|_{r=R} = A_z\Big|_{r=R} = 0,$$
$$\Phi\Big|_{z=0} = \Phi\Big|_{z=L} = 0, \ \frac{\partial A_z}{\partial z}\Big|_{z=0} = \frac{\partial A_z}{\partial z}\Big|_{z=L} = 0.$$
(9)

Компоненты полей пучка вычисляются по формулам дифференцирования потенциалов:

$$E_z = -\frac{\partial \Phi}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial t}, \ E_r = -\frac{\partial \Phi}{\partial r}, \ B_\theta = -\frac{\partial A_z}{\partial r}.$$
 (10)

Численные расчеты и анализ результатов

Моделирование самосогласованной динамики пучка проводится путем численного решения системы уравнений (1)—(10). Уравнения движения (1) интегрируются методом Рунге—Кутта второго порядка точности. По распределению макрочастиц в расчетной области вычисляются сеточные плотности заряда и тока по формулам (4)—(8). Далее итерационным методом решаются уравнения Пу-



Рис. 2. Импульс тока на входе (1) и транспортируемый ток пучка (2)

ассона (2), (3), (9) для потенциалов, и по формулам численного дифференцирования вычисляются компоненты собственных полей (10). Алгоритм решения реализован в среде MatLab.

При моделировании параметры пучка и плазмы выбирались подобными экспериментальным по транспортировке сильноточных пучков в плазмонаполненных трактах транспортировки [2–3]: энергия электронов пучка $W_0=10...40$ кэВ, ток пучка $I_0=1...10$ кА, температура плазмы 2 эВ, давление газа $p=10^{-1}$ Па, степень ионизации газа 10 %, плотность плазмы $n_0=10^{10}...10^{12}$ см⁻³, индукция магнитного поля $B_z^*=0,1...10$ кГс. Исследования проводились для камеры с параметрами: L=20 см, R=5 см; радиус пучка: $R_b=2,5$ см.

Инжектируемый ток пучка изменяется во времени по закону:

$$I(t) = \begin{cases} I_0(t/\tau_{\phi}) & \text{при } 0 < t < \tau_{\phi}, \\ I_0 & \text{при } t > \tau_{\phi}. \end{cases}$$

Здесь τ_{ϕ} , I_0 – длительность фронта импульса тока и его амплитуда.

На рис. 2–9 приведены результаты численного эксперимента при $I_0=5$ кА, $n_0=2\cdot10^{11}$ см⁻³, $B_z^*=3$ кГс, $\tau_{\Phi}=12$ нс.

По общей картине эволюции пучка видно, как в процессе транспортировки пучок проходит переходный режим, выходя в стационарное состояние транспортировки за время ~10...15 нс (рис. 2). Переходный режим транспортировки соответствует периоду времени, когда электроны плазмы (рис. 3, *a*, 4, *a*) постепенно (за время ~10...15 нс) покидают область дрейфа пучка в направлении торцов трубы, выталкиваемые образовавшимся электрическим потенциалом. Электроны плазмы покидают область в сторону входа и выхода в среднем, примерно, в равном соотношении (рис. 5, δ). Различие в выходе выражено небольшой задержкой (~3 нс), вызванной более близким расположением плоскости инжекции к входу и временем, необходимым для наработки потенциала. Покидающие область электроны плазмы увеличивают роль ионов в компенсации заряда пучка (рис. 7, *a*, δ).

Однородность профиля пучка по радиусу (рис. 3, б и 4, б) обеспечивается внешним магнитным полем, удерживающим пучок от расплывания по радиусу.

В переходном режиме в области пучка происходят колебания плотности заряда пучка, что приводит к образованию локальных периодических виртуальных катодов, которые разбивают пучок на отдельные сгустки (рис. 3, δ). При этом потери пучка составляют до 25 % (рис. 5, *a*).

Степень и однородность зарядовой нейтрализации возрастает с течением времени по мере выхода на стационарный режим (рис. 7, δ), что соответствует более полному выходу электронов плазмы из области транспортировки (рис 4, *a*). Локальные



Рис. 3. Конфигурационные портреты электронов плазмы (а) и пучка (б) в плоскости {r, z} в момент времени 3 нс



Рис. 4. Конфигурационные портреты электронов плазмы (а) и пучка (б) в плоскости {r,z} в момент времени 14 нс



Рис. 5. Зависимость тока пучка (а) и плазмы (б) от времени на торцах трубы на входе (2) и выходе (1)

возмущения плотности заряда согласуются с неоднородностями пучка и плазмы.

Образование вихревого электрического поля в переходном режиме $E_z = (\partial A_z / \partial t)$ (рис. 9, *a*, *б*, кривая 2) приводит к частичной токовой нейтрализации и, следовательно, к компенсации собственного магнитного поля в системе. Однако, из-за конечной проводимости плазмы, индукционные токи со временем затухают (рис. 8, *б*, кривая 2).

Заключение

Определена роль переходного процесса в формировании стационарного режима транспортировки сильноточного электронного пучка в плазме низкого давления, от которого зависит время выхода тока на стационарный режим, развитие неустойчивостей и транспортируемый ток пучка.

Показано, что в переходном режиме в результате возмущений полей формируются локальные



Рис. 6. Фазовый портрет пучка в моменты времени 3 нс (а) и 14 нс (б)



Рис. 7. Плотность заряда пучка (1), плазмы (2) и результирующая сумма (3) в моменты времени 3 нс (а) и 14 нс (б)



Рис. 8. Плотность тока пучка (1), индукционного тока (2) и результирующая сумма (3) в моменты времени 3 нс (а) и 14 нс (б)



Рис. 9. Значения компонент электрического поля вдоль оси z для $-(\partial \Phi/\partial z)$ (1), $-(\partial A_z/\partial t)$ (2) и результирующая сумма E_z (3) в моменты времени 3 нс (a) и 14 нс (б)

виртуальные катоды, это приводит к торможению электронов пучка и частичному отражению электронов в строну плоскости инжекции.

Доказано, что определяющими для переходного режима являются зарядовая нейтрализация пучка. Минимизацию потерь транспортируемого тока можно обеспечить за счет подбора параметров пучка и плазмы, влияющих на зарядовую нейтрализа-

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Григорьев В.П., Коваль Т.В., Кухта В.Р., Рахарджо П., Уемура К. Исследование транспортировки и фокусировки низкоэнергетического электронного пучка в ионизованном аргоне низкого давления // Журнал технической физики. – 2008. – Т. 78. – № 1. – С. 104–108.
- Крейндель М.Ю., Литвинов Е.А., Озур Г.Е., Проскуровский Д.И. Нестационарные процессы в начальной стадии формирования сильноточного электронного пучка в плазмонаполненном диоде // Физика плазмы. – 1991. – Т. 17. – № 12. – С. 1425–1431.
- Назаров Д.С., Озур Г.Е., Проскуровский Д.И. Генерация низкоэнергетичных сильноточных электронных пучков в пушке с плазменным анодом // Известия вузов. Физика. – 1994. – Т. 37. – № 3. – С. 100–114.

цию: тока пучка, плотности плазмы, длительность фронта тока пучка.

Учет токовой нейтрализации позволяет обеспечить в переходном периоде более устойчивое состояние пучка, за счет компенсации собственного магнитного поля. Это позволяет сократить время выхода пучка на стационарный режим.

- Григорьев В.П., Вагин Е.С., Офицеров В.В. Модель макрочастиц зарядовой нейтрализации электронного пучка при инжекции в плазму низкого давления // Известия Томского политехнического университета. – 2010. – Т. 316. – № 2. – С. 85–89.
- Григорьев В.П., Вагин Е.С., Офицеров В.В. Моделирование зарядовой нейтрализации электронного пучка при инжекции в плазму низкого давления // Известия вузов. Физика. – 2009. – Т. 52. – № 11/2. – С. 91–95.
- Хокни Р., Иствуд Дж. Численное моделирование методом частиц. – М.: Мир, 1987. – 640 с.

Поступила 28.12.2010 г.

УДК 681.31:533.95

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАЗМЕННОГО КАНАЛА НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ПУЧКОМ В АРГОНЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

В.П. Григорьев, И.Л. Звигинцев

Томский политехнический университет E-mail: 8b20@sibmail.com

Представлена модель образования плазменного канала при транспортировке низкоэнергетического сильноточного электронного пучка в аргоне низкого давления. Рассмотрены процессы ионизации в условиях полной и неполной зарядовых нейтрализаций пучка при наложении сильного внешнего магнитного поля. Рассчитаны времена полной зарядовой нейтрализации пучка. Определена зависимость плазменного тока от времени на переднем и заднем фронтах импульса тока инжектируемого пучка.

Ключевые слова:

Пучок, плазма, плазменный канал, аргон. **Key words:** Beam, plasma, plasma channel, argon.

Введение

Одним из основных применений низкоэнергетических сильноточных электронных пучков является модификация поверхностных слоев материалов. Привлекательность таких пучков заключается в их способности переносить энергию без существенных потерь на достаточно большие расстояния и эффективно передавать ее объекту воздействия. Трудности, возникающие при транспортировке пучка, связаны с образованием виртуального катода при неполной нейтрализации пучка, который запирает пучок на входе в пространство дрейфа. При полной же зарядовой нейтрализации опасность потери тока вызывает самопинчевание пучка в собственном магнитном поле. Поэтому при транспортировке стараются добиться полной зарядовой нейтрализации пучка, а эффект самопинчевания ослабить за счет внешнего магнитного поля [1].

Существующие модели транспортировки электронных пучков в газе и плазме нельзя применить, так как они ориентированы либо на сравнительно высокие плотности плазмы, давления газа p>13,3 Па и короткие импульсы тока, либо на низкие давления и низкие токи электронного пучка (до 10 A) [2, 3]. Кроме того, особенностью технологических систем является использование электронных